PAT-NO:

to the state of

JP401081290A

DOCUMENT-IDENTIFIER: JP 01081290 A

TITLE:

WAVELENGTH-VARIABLE SEMICONDUCTOR LASER

PUBN-DATE:

March 27, 1989

INVENTOR - INFORMATION:

NAME

TATO, NOBUYOSHI

ASSIGNEE-INFORMATION:

NAME

COUNTRY

SUMITOMO ELECTRIC IND LTD

N/A

APPL-NO:

JP62237983

APPL-DATE:

September 22, 1987

INT-CL (IPC): H01S003/18, H01F005/08, H01L039/00

US-CL-CURRENT: 372/43

ABSTRACT:

PURPOSE: To reduce the generation of heat and to change a wavelength of a laser beam by changing the strength of a magnetic field to be impressed on a semiconductor laser element from a superconducting coil arranged near semiconductor laser element.

CONSTITUTION: A semiconductor laser element 2 and a superconducting coil 1 are fixed to a heat sink 4 to be adjacent to each other. The superconducting coil 1 controls a magnetic field to be impressed on the semiconductor laser

element 2 and changes a wavelength of an output laser beam.

Accordingly, a

problem of the generation of heat is hardly caused. A composite oxide

superconductor to be used for the superconducting coil 1 is expressed by

Formula (1) (where α is a group IIa element in the periodic table, β

is a group IIIa element in the periodic table, γ is one element selected

from a group Ib, a group IIb, a group IVb and a group VIIIa

elements in the periodic table and x, y and z are numbers satisfying the

following conditions: 0.1≤x≤0.9, 0.4≤y≤3.0 and 1≤z≤5). This

composite oxide is composed mainly of a perovskite oxide or a pseudoperovskite oxide.

COPYRIGHT: (C) 1989, JPO&Japio

T 40 / 1

四公開特許公報(A) 昭64-81290

⑤Int.Cl.・ 識別記号 庁内整理番号 ・ ⑥公開 昭和64年(1989)3月27日 H 01 S 3/18 H 01 F 5/08 Z A A Z - 6447-5E H 01 L 39/00 Z A A 8728-5F 審査請求 未請求 発明の数 1 (全 4 頁)

公発明の名称 波長可変半導体レーザ

②特 朗 昭62-237983

受出 頭 昭62(1987)9月22日

⑫発明者 田遠 伸好

神奈川県横浜市栄区田谷町1番地 住友電気工業株式会社

横浜製作所内

①出 願 人 住友電気工業株式会社

大阪府大阪市東区北浜5丁目15番地

迎代理人 弁理士 越場 隆

明報書

1. 発明の名称 波長可変半導体レーザ

2. 特許請求の範囲

(1) 半導体レーザ素子に近接して超電導コイルを 配置し、該超電導コイルから半導体レーザ素子に 印加する磁場の強度を変化させることにより、レ ーザ光の波長を変化させることを特徴とする波長 可変半導体レーザ。

(2) 上記超電導コイルに用いられている超電導体が

一般式: (α_{1-x}β_x) γ_yO_s

(但し、 α 、 β 、rは、上記定義の元素であり、xは $\alpha+\beta$ に対する β の原子比で、 $0.1 \le x$ ≤ 0.9 であり、yおよびzは $(\alpha_{1-x}\beta_x)$ を 1 とした場合に $0.4 \le y \le 3.0$ 、 $1 \le z \le 5$ と t な原子比である)

で表される組成の複合酸化物超電導体であること

を特徴とする特許請求の範囲第1項に記載の波長 可変半導体レーザ。

- (3) 上記複合酸化物超電導体が、ペロブスカイト型または擬似ペロブスカイト型酸化物であることを特徴とする特許請求の範囲第1項または第2項に記載の波長可変半導体レーザ。
- (4) 上記複合酸化物超電導体が、8a、YおよびCu を含むことを特徴とする特許請求の範囲第1項乃 至第3項のいずれか1項に記載の波長可変半導体 レーザ。
- (5) 上記複合酸化物超電導体が、Y2O3、CuOおよびBaCuO。を焼結した焼結体であることを特徴とする特許請求の範囲第1項乃至第4項のいずれか1項に記載の披長可変半導体レーザ。

3. 発明の詳細な説明

産業上の利用分野

本発明は、波長可変半導体レーザに関し、さらに詳細には、超電導コイルを使用して小型化された発熱の少ない波長可変半導体レーザに関する。

従来の技術

従来、液長可変半導体レーザにはMQW(量子井戸型)、DFB(分布帰還型)、DBR(ブラッグ反射型)等の発振液長を変えることが可能な半導体レーザがあるが、いずれも出力液長は電流で制御している。

一方、半導体レーザ素子に磁場を印加し、その 磁場の強度を変化させることにより、出力レーザ 光波長を変化させることは、原理的には可能 る。しかしながら、そのためには、半導体レーザ 素子に強い磁場を印加する必要があり、従来は十 分な強度の磁場を発生することができる小型の磁 石がなかった。従って、磁場で変調する波長可変 半導体レーザを小型デバイスとして実現すること

体レーザ素子に印加する磁場の強度を変化させる ことにより、レーザ光の被長を変化させることを 特徴とする波長可変半導体レーザが提供される。

本発明に用いる超電導コイルは、複合酸化物超電導体を使用していることが好ましい。この複合酸化物超電導体は、下記一般式:

 $(\alpha_{1-x}\beta_{x})\tau_{x}O_{x}$

(但し、 α は周期律表 Π a 族に含まれる元素であり、 β は周期律表 Π a 族に含まれる元素であり、 τ は周期律表 Π b、 Π b、 Π b、 Π b、 Π a および Π a 族から選択される少なくとも一つの元素であり、X、Y、Z はそれぞれ $0.1 \le X \le 0.9$ 、 $0.4 \le Y \le 3.0$ 、 $1 \le Z \le 5$ を満たす数である)

で示される複合酸化物で構成されることが好ましい。これらの複合酸化物はペロブスカイト型また は擬似ペロブスカイト型酸化物を主体としたもの と考えられる。

上記周期律表Ⅱa族元素αとしては、Ba、Sr、 Ca、Mg、Be等が好ましく、例えば、Ba、Srを挙げ ができなかった。

発明が解決しようとする問題点

上記のように、従来の被長可変半導体レーザは、 半導体レーザ素子に流す電流を変化させることに より、被長を変えるものであった。そのため、発 熱量が多く、光集積回路で用いる場合等に実装密 度を上げることができないという問題があった。

また、半導体レーザ条子に磁場を印加し、印加する磁場の強度により出力レーザ光の波長を制御する方法では、従来磁場の発生手段が大きくなり過ぎ、実用性がなかった。

従って、本発明は、上記従来の問題点を解決した発熱の少ない小型デバイスとしての波長可変半導体レーザを提供することを目的とするものである。

問題点を解決するための手段

本発明に従うと、半導体レーザ業子に近接して 超電導コイルを配置し、該超電導コイルから半導

ることができ、この元素αの10~80%をMg、Ca、Srから選択された1種または2種の元素で置換することもできる。また上記周期律表Ⅲ a 族元素βはとしては、Y、La、Sc、Ce、6d、Ho、Br、Tm、Yb、Lu等が好ましく、例えばY、Laとすることができ、この元素βのうち、10~80%をScまたはLa以外のランタノイド元素から選択された1種または2種の元素で置換することもできる。前配元素rは一般にCuであるが、その一部を周期律される他の元素、例えば、Ti、V等で置換することもできる。

作用

本発明の波長可変半導体レーザは、磁場発生手 酸として超電導コイルを用い、半導体レーザ素子 に印加する磁場を変化させることで出力レーザ光 の波長を変えるところにその主要な特徴がある。

従来の波長可変半導体レーザは、半導体レーザ 条子に流す電流を変えることで出力レーザ光の波 長を制御していた。そのため、発熱等の問題があ り、光集積回路の実装密度の向上を妨げていた。

本発明の被長可変半導体レーザは、磁場発生手 段として超電導コイルを用い、半導体レーザ素子 に印加する磁場を制御することにより、出力レー が光の被長を変えている。従って、発熱の問題は ほとんど生じない。

本発明の被長可変半導体レーザは、磁場中において半導体レーザ素子のエネルギー帯が、多くのサブパンド、すなわち、ランダウ準位に分裂することを利用して出力レーザ光の被長を制御している。一方、そのため半導体レーザの活性層に流す電流の大きさを制御することにより、発光強度を制御することもできる。

本発明の放長可変半導体レーザの超電導コイル に用いる超電導体としては、YBCOと称される Y₁Ba₂Cu₂O_{7-x}に代表される複合酸化物超電導体 が好ましい。上配の複合酸化物超電導体を作製す るにはY₂O₃、CuOおよびBaCuO₂を挽続する方 法によることが好ましい。これは、特に不純物が 少なく、安定した超電導特性を有する複合酸化物 超電導体を得るのに有効である。

上記の超電導体を用い、本発明の波長可変レーザに用いる超電導コイルを作製するには、以下の工程による。BaCOaおよびCuO粉末を混合加熱してBaCuO。とする。Y2Oa、CuOおよびBaCuO。粉末を混合、酸素含有雰囲気で焼結して得た焼結体を粉砕し、粉末とした後、所望の形状に成形し、再び酸素含有雰囲気で焼結する。必要に応じ、焼結一粉砕一成形の工程は数回繰り返すことが好ましい。

寒疮例

以下に本発明を実施例により説明するが、以下の開示は本発明の一実施例に過ぎず本発明の技術 的範囲を何等制限するものではないことは勿論で ある。

以下、図面を参照して本発明の被長可変半導体 レーザを説明する。第1図は、本発明の被長可変 レーザの斜視図であり、第2図は、側面図である。

本実施例において、半導体レーザ素子 2 はヒート シンク 4 上にダイポンドにて固定されている。

さらに超電導コイル1は、該半導体レーザ素子 2の活性層5全体が、超電導コイル1で発生する 磁場で完全に包含されるよう、ヒートシンク4上 に固定されている。

超電導コイル1は、以下のように作製した。 純度3N以上、平均粒径5μm以下のBaCO。お よびCuO粉末とを混合、加熱してBaCuO。とした。 このBaCuO。を粉砕して平均粒径10μm以下の粉末とし、やはり純度3N以上、平均粒径5μm以下の外でのY。O。粉末およびCuO粉末とY:Ba:Cuの原子比が1:2:3の比となるようボールミルにより混合した。この混合粉末を大気中において920で焼結し、再びボールミルで平均粒径10μm以下に粉砕した。この混合物末をカイルの形状に成形したで粉砕した。この協結一粉砕の工程を3回行って得た複合酸化物粉末をコイルの形状に成形した。10時間焼結した後7℃/分の冷却速度で冷却した。このような工程で得られた超電導コイルは、106 Kで抵抗が完全に0となった。 上配の、超電導コイルは、当然小型かつ低電力で、発熱は全くないにもかかわらず、きわめて強い磁場を発生する。また、そのため半導体レーザ素子と超電導コイルを同一ヒートシンク上にコンパクトに実装することが可能である。さらに、半導体レーザおよび超電導コイルによる電磁石の位置決めが、容易に行えるようになれば、1チップ化することさえ可能である。

第3図(a)、(c)は、面発光型半導体レーザ案子を 用いた実施例の断面図および平面図である。また、 第4図(a)、(c)は、埋込型の半導体レーザ素子を用いた実施例の断面図および平面図である。このように、本発明の波長可変レーザは、半導体レーザ 素子の形状に左右されることなく実現できる。

発明の効果

以上辞述したように本発明の被長可変半導体レーザは、従来と異なり、磁場により液長を制御する全く新規なものである。これは、本発明に独特な複合酸化物超電導体を用いた超電導コイルによ

り初めて実現可能となった。

本発明は、光メモリの読み込み・書き込みの両 用レーザやフォトケミカルホールパーニング、ノ ンフォトケミカルホールパーニングを利用した光 メモリの読み込み・書き込み用波長可変レーザ、 ポンププローブ分光を利用した非線形分光装置、 並びに2波長切換による光スイッチおよび光コン ピュータへ応用可能である。さらに、多数の波長 を用い、光多重通信へ応用することも効果的である。

4. 図面の簡単な説明

第1図は、本発明の波長可変半導体レーザの斜 視図であり、

第2図は、第1図実施例の側面図であり、.

第3図(a)は、面発光型半導体レーザ素子を用いた実施例の断面図であり、

第3図的は、第3図(a)の実施例の平面図であり、 第4図(a)は、埋め込み型半導体レーザ業子を用 いた実施例の断面図であり、 第4図的は、第4図回の実施例の平面図である。

〔主な参照番号〕

1・・・超電導コイル、

2・・・半導体レーザ業子、

3・・・ワイヤ、

4・・・ヒートシンク、

5・・・活性層

特許出願人 住友電気工業株式会社 · 代 理 人 弁理士 越 場 隆

